

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成18年1月19日(2006.1.19)

【公開番号】特開2005-290155(P2005-290155A)

【公開日】平成17年10月20日(2005.10.20)

【年通号数】公開・登録公報2005-041

【出願番号】特願2004-105868(P2004-105868)

【国際特許分類】

C 0 8 G 81/00 (2006.01)

B 3 2 B 15/08 (2006.01)

B 3 2 B 15/088 (2006.01)

C 0 8 G 18/65 (2006.01)

C 0 8 G 73/10 (2006.01)

C 0 8 G 77/14 (2006.01)

【F I】

C 0 8 G 81/00

B 3 2 B 15/08 J

B 3 2 B 15/08 R

C 0 8 G 18/65 A

C 0 8 G 73/10

C 0 8 G 77/14

【手続補正書】

【提出日】平成17年11月25日(2005.11.25)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0017

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0017】

で表される化合物が挙げられる。一般式(1)中、 R^1 は、互いに独立して炭素数が2~6のメチレン基またはフェニレン基であり、好ましくは3~5のメチレン基である。 R^2 は、互いに独立して炭素数1~4のアルキル基またはフェニル基を示し、繰り返し単位数nは3~30程度、好ましくは3~20を示す。nの数が3より小さいと反りが生じやすくなる傾向があり、またnの数が20を超えると有機溶媒に対する溶解性が低下する傾向があるので、前記程度のものが適当である。成分(a2)の具体例としては、 $\text{--(CH}_2\text{)}_2\text{--}$ -ビス(2-ヒドロキシエチル)ポリジメチルシロキサン、 $\text{--(CH}_2\text{)}_3\text{--}$ -ビス(3-ヒドロキシプロピル)ポリジメチルシロキサン、 $\text{--(CH}_2\text{)}_4\text{--}$ -ビス(4-ヒドロキシブチル)ポリジメチルシロキサン、 $\text{--(CH}_2\text{)}_5\text{--}$ -ビス(5-ヒドロキシペンチル)ポリジメチルシロキサン、 $\text{--(CH}_2\text{)}_3\text{--}$ -ビス[3-(2-ヒドロキシフェニル)プロピル]ポリジメチルシロキサン、 $\text{--(CH}_2\text{)}_3\text{--}$ -ビス[3-(2-ヒドロキシフェニル)プロピル]ポリジメチルシロキサンなどを例示でき、これらは1種単独で又は2種以上を組み合わせで使用される。これらのうち汎用性の高い $\text{--(CH}_2\text{)}_3\text{--}$ -ビス(3-ヒドロキシプロピル)ポリジメチルシロキサン(ダウコーニングアジア(株)製 ペインタッド8579、DK X8-8579-4、旭化成ワッカーシリコン(株)製 IM-11)を使用するのがより好ましい。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0059

【補正方法】変更

